

KAYAKU Microchem 正电子束光刻胶 PMMA950 C9

产品名称	KAYAKU Microchem 正电子束光刻胶 PMMA950 C9
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

AR-PC 5090.02 /5091.02 电子束曝光用导电胶，不含光敏物质。

在绝缘衬底上做电子束曝光时，为了避免电荷累积，大家通常会选择涂一层导电胶，来消除电荷累积。在正常的曝光结束后，导电胶会溶于水中，非常容易去除，不会影响正常的电子束曝光工艺。AR-BR 5400 双层 Lift-Off 工艺底层胶可以得到稳定的 Lift-off 结构，利于金属的沉积。在制作双层工艺时，需要和正胶 AR-P 3500 或 AR-P 3500T 配合使用。从 270nm 到红外区，有良好的光学透明性，热稳定性好。AR-PC 500 耐酸碱保护胶在酸碱中有很好的耐刻蚀性能，不含光敏物质。尤其在碱性环境（40% KOH）中非常稳定。一般涂于衬底背面，防止刻蚀工艺中的化学物质损害其背面结构。503 颜色为黑色，较 504 耐刻蚀性能稍弱。SX AR-PC 5000/40 耐酸碱保护胶在酸碱中有很好的耐刻蚀性能，不含光敏物质。在 40% 的 KOH 和 50% 的 HF 中，具有很好的保护作用的，耐刻蚀时间可以长达数小时。另外，还可以和正胶配合使用，通过双层工艺来制作图形。AR-P 5910 耐 HF 酸刻蚀光刻胶，正胶对基底有很好的粘附